**ANNEAL真空退火炉**



* **产品简介：**
 ANNEAL真空退火炉是英国MOORFIELD公司的一款桌面式高真空退火装置，最高温度为1000℃，真空度可达5×10-7mbar，并且可以精密控制退火的气氛，样品最大尺寸为6寸，是二维材料及薄膜器件退火的理想选择工具之一。
* **产品特性及主要参数：**

• 桌面型真空退火装置

• **样品最大尺寸：6寸或者4寸圆片**

• 温度有两个方案可供选择：

 1）1000℃高温：加热材料为SIC涂层的石墨材料或者CCC材料，分辨率±1℃

 2）600℃高温：采用石英灯加热，兼容普通空气环境，价格便宜，分辨率±1℃

• 高精度气体控制：在退火时可支持3通道气体控制： Ar，O2与N2，质量流速可控。

• 极高分辨率压力全自动控制：低至0.1mbar，退火是压力的而控制至关重要，尤其是二维材料，纳米薄膜材料，压力控制的越精准越好。

• 真空度低至<5 × 10-7 mbar

• 操作简单

• 可自定义退火程序并具有储存功能

• 维护简单

• 操作及其安全，有各种安全保护装置

• 兼容超净间



 退火炉结构图



 加热台外观图

* **产品应用：**

• 纳米薄膜退火处理

• 二维材料退火处理

• 金属材料，陶瓷材料等退回处理

* **典型用户：**

• **the University of Exeter(UK)**

• **the University of Manchester(UK)**

• ICFO – The Institute of Photonic Sciences ( Spain)

• the University of Cambridge and Nokia Research Centre (UK)